Univerzitet u Novom Sadu

.

Prirodno-matematički fakultet

Institut za fiziku

Природно-математички факултет

Радна заједница заједничких послова

Npa	11	-04-	1990
Opr. jeд.	pb. ì	965ábi	Вредновт
03	10/25		

Fedor Skuban

KRISTALIZACIONI AFINITET U SISTEMU Cu-As-Se

(diplomski rad)

Novi Sad, 1990.

Ovim putem želim da izrazim svoju zahvalnost:

Dr Dragoslavu Petroviću, profesoru Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, koji je kao mentor pomogao pri izboru teme, u realizaciji eksperimenta i interpretaciji rezultata;

Mr Svetlani Lukić, asistentu na predmetu Fizika čvrstog stanja, koja mi je pomogla u tehničkoj pripremi i realizaciji ovog rada.

SADRŽAJ

.

-

Uvod	4
TEORIJSKI DEO	
I. Fotoosetljivi halkogenidni staklasti poluprovodnici .	8
I.1. Osnovne osobine HSP	8
I.2. Formiranje staklastog stanja	10
I.3. Fotoosetljivost kod HSP	12
I.4. Teorijske pretpostavke o mehanizmu fotostruktur-	
nih promena kod HSP	15
II. Tendencija ka kristalizaciji kod halkogenidnih stak-	
lastih poluprovodnika	18
II.1. Ponašanje halkogenidnih amorfnih sistema sa	
temperaturnim promenama	18
II.2. Kristalizacija u sistemu Cu-As-Se	20
III. Metode za karakterizaciju kristalne sposobnosti kod	
sistema Cu-As-Se	22
III.1. Difrakciona analiza na višim temperaturama	
na polikristalu	22
III.2. Diferencijalna termička analiza	23
III.3. Infracrvena (IC) spektroskopija	24
III.4. Ramanska spektroskopija	25
EKSPERTMENTALNT DEO	-/
Sinteza	•
\mathbb{T}_{rmi}	28
$\begin{array}{c} \text{Rendgensks englise de E00}^{\text{O}}\text{d} \end{array}$	22
Dighusi ja pogultoto	57
	43
Dartjugar	46
Literatura	47

Poluprovodnici su materijali specifičnih fizičkih osobina, čija je primena veoma široka i raznovrsna, naročito u elektronici, informatici, tehnici mernih uređaja itd. Iz njihovog naziva se može zaključiti da se u određenim uslovima ponašaju kao izolatori, dok se u drugim ponašaju kao provodnici, odnosno da imaju osobine i jednih i drugih /l/. I dok su kristalni poluprovodnici relativno široko proučeni i za njih postoji definisana teorija koja objašnjava procese električnog provođenja u njima, dotle su amorfni poluprovodnički materijali slabije izučavani. Tek se u poslednjih dvadesetak godina posvećuje više pažnje amorfnoj strukturi, teorijskim osnovama tretiranja neuređenih sistema i primeni ovakvih materijala.

Amorfni materijali se odlikuju odsustvom dugodometnog uređenja strukture, odnosno odsustvom njene trodimenzionalne periodičnosti /l/. Ipak, raspored atoma u takvim telima nije sasvim slučajan, ali može se govoriti samo o kratkodometnom uređenju strukture. Drugim rečima, elementarne ćelije, kao najmanji uređeni delići čvrstog tela, postoje i u amorfnom stanju, ali su one dezorijentisane, haotično usmerene jedne u odnosu na druge, a dužina atomskih veza i uglovi između njih nisu konstantne veličine, već variraju u izvesnom intervalu vrednosti. Takođe, hemijske veze su u velikoj meri nezasićene /2/. Naime, amorfno stanje bi se moglo okarakterisati kao agregatno stanje sa prekidima u strukturi i sasvim razvijenom površinom. Ono se nalazi negde između kristalnog i tečnog. Uzajamni raspored najbližih čestica (ili najbližih koordinacionih sfera) je, u prvoj aproksimaciji, kao kod tečnosti, a sposobnost prema izmeni tog stanja je kao kod kristala /3/. Amorfne supstance su izotropne u pogledu mehaničkih, električnih, optičkih i drugih osobina, a eventualno odstupanje od toga je posledica delovanja spoljašnjih faktora /4/.

Amorfna čvrsta tela se mogu dobijati na dva osnovna načina /1/:

- nanošenjem na podlogu putem raspršivanja,

- hlađenjem rastopa.

Na prvi način dobijamo tanke filmove, a na drugi masivne uzorke. Ako se materijal može dobiti u amorfnom stanju hlađenjem rastopa, onda se po pravilu može dobiti i raspršivanjem. Materijali, dobijeni hlađenjem rastopljene mase, nazivaju se staklima.

U ovom radu će biti reči isključivo o staklastim poluprovodnicima. Oni se mogu razvrstati na više načina. Jedan od njih je prema strukturi /1/:

- tetraedarska,

- slojna,

- ikosaedarska i

- lančana.

Drugi način klasifikacije je prema hemijskom sastavu /3/:

- elementarna stakla,
- oksidna stakla,
- halkogenidna stakla,
- halogenidna stakla i
- kombinovana stakla.

Tema ovog rada su jedinjenja sistema Cu-As-Se, koja svrstavamo u halkogenidne staklaste poluprovodnike (HSP) i zato će ovde biti više reči upravo o toj klasi amorfnih materijala.

HSP su stakla u čiji sastav ulaze sulfidi, selenidi ili teluridi elemenata četvrte i pete grupe periodnog sistema, tj. u binarnom obliku su tipa $A^{IV}-B^{VI}$ ili $A^{V}-B^{VI}$. Sa njima u sastav halkogenidnih stakala mogu ući skoro svi poznati elementi i tako se grade trokomponentni sistemi: A^V - $-B^{VI}-C^{VII}$, $M-A^{V}-B^{VI}$ ili još složenija stakla kao $M-A^{V}-B^{VI}$ -C^{VII} (M - bilo koji element periodnog sistema; A^{IV} - Si, Ge, Pb; $A^{V} - P$, As, Sb; $B^{VI} - S$, Se, Te; $C^{VII} - Cl$, Br, J). Kombinovanjem sastavnih komponenti, kao i odabiranjem režima sinteze utiče se na fizičko-hemijska svojstva stakala, zbog čega su posebno interesantna u izradi elektronskih i specijalnih optičkih elemenata. Naročiti značaj imaju fotoosetljivi halkogeni staklasti poluprovodnici. Kod njih se javlja promena optičkih (koeficijent apsorpcije, indeks prelamanja), ali i drugih osobina pod dejstvom svetlosti, što omogućava njihovo korišćenje u uređajima za optičko holografsko zapisivanje, odnosno obradu informacija /5/. Mogu se postići dobre razlagajuće sposobnosti i reverzibilnost zapisa. Pod tim se podrazumeva da se, pod određenim uslovima, može brisati optički zapis i ponovo takva stakla koristiti u procesu zapisivanja informacija.

Sistem Cu-As-Se upravo u smislu mogućnosti fotozapisa ima pozitivne karakteristike /6, 7/. Međutim, materijal sa perspektivom za praktičnu upotrebu mora imati stabilne fizičko-hemijske osobine. Za amorfne sisteme veoma bitna karakteristika je i mogućnost izbegavanja pojave kristalizacionih centara. Istovremeno, simulirana kristalizacija može da doprinese razjašnjenju strukturnih osobenosti i neuređene faze.

Ovaj rad treba da pruži skroman doprinos u ovom smislu.

TEORIJSKI DEO

.

.

I. FOTOOSETLJIVI HALKOGENIDNI STAKLASTI POLUPROVODNICI

I.l. Osnovne osobine HSP

Halkogenidna stakla, kao što je u uvodu rečeno, su materijali koji spadaju u poluprovodnike pre svega prema svojim električnim osobinama (u zonskoj slici energetskih stanja u takvim materijalima veličina energetskog procepa izmedu dve dozvoljene zone je od 0,2 do 3,0 eV). Ubrajaju se i u stakla po odsustvu uređenja dugog dometa u strukturi, a u halkogenide po tome što sadrže sulfide, selenide ili teluride elemenata IV i V grupe periodnog sistema, tj. kao binarni sadrže jedinjenja tipa $A^{IV}-B^{VI}$ ili $A^{V}-B^{VI}$ (A^{IV} - Si, Ge, Pb; A^{V} - P, As, Sb; B^{VI} - S, Se, Te).

Otkriće HSP je vezano za 50-te godine ovog veka i imena sovjetskih naučnika B. T. Kolomijca i N. A. Gorjunove, čiji prvi radovi su opisivali uslove sinteze i osnovna fizička i hemijska svojstva /8/. Nabrojačemo osnovne osobine, kao i neka specifična svojstva vezana za HSP.

- Specifična provodljivost HSP je elektronske prirode i sa promenom sastava se menja u granicama $10^{-3} - 10^{-17} \Omega^{-1} cm^{-1}$.

- Optička širina zabranjene zone je 0,2 - 3,0 eV.

- Indeks prelamanja iznosi 4,6 - 1,8 (za λ = 1,06 μ m).

- Primese koje se uvode u stakla preko rastopa bitno ne menjaju ni veličinu ni tip provodnosti. Legiranje stakala preko raspršivanja metalima kao što su Ni, Fe, Mo... suštinski menja veličinu i tip provodljivosti. Neki podaci ukazuju da veći uticaj na elektroprovodljivost od primesa imaju defekti. Ovo je jedna od najspecifičnijih osobina staklastih poluprovodnika. Ovi materijali se, naime, uvek ponašaju kao sistemi sa nezasićenim vezama, što se tumači prisustvom velikog broja lokalnih centara, uslovljenih odsustvom dugodometnog uređenja. Ovi centri omogućavaju prenaelektrisavanje primesnih centara, što čini primese električki neaktivnim pri njihovom uvođenju u staklo preko rastopa. Drugo tumačenje traži uzrok neosetljivosti električnih osobina na primese u visokoj koncentraciji defekata /8/.

- Nosioci naelektrisanja u HSP imaju malu pokretljivost

 $(10^{-1} - 10^{-7} \text{ cm}^2 \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{s}^{-1})$ koja je uslovljena specifičnim mehanizmima prenosa /9/, kao i visok specifični otpor $(10^{10} - 10^{14} \Omega \cdot \text{cm})$ /10/ stakala sa relativno uzanim energetskim procepom od 1,2 do 1,8 eV.

- Svi HSP imaju p-tip provodljivosti koja može da raste za nekoliko redova veličine pri izomorfnoj zameni sumpora selenom i selena telurom.

- HSP su visoko prozračni u širokoj spektralnoj oblasti.

- Poseduju mogućnost povratne i nepovratne strukturne i elektronske promene pod uticajem elektromagnetnog polja (svojstvo fotoosetljivosti).

- HSP imaju anomalni karakter temperaturne zavisnosti fotoprovodnosti.

- Za razliku od drugih klasa, halkogenidna stakla poseduju veze koje su tek 0 - 12% jonske, znači pretežno su homeopolarne. Uzrok leži u atomskoj konfiguraciji i ređanju u strukturi jona iste vrste, umesto naizmeničnog ređanja pozitivnih i negativnih jona.

- Važna osobina je i postojanost prema dejstvu zračenja, naročito jonizujućeg i neutronskog zračenja, što se tumači neuređenošću strukture /11/.

- HSP praktično ne reaguju sa vodom, rastvorima kiselina i organskim rastvaračima i imaju veliku hemijsku postojanost u odnosu na većinu agresivnih supstanci.

- Poseduju unutrašnji fotoefekat.

- Imaju sposobnost da im se osobine menjaju promenom uslova sinteze, a bez promene sastava. To je tzv. ekekt tehnološkog modifikovanja kojim se utiče na većinu fizičkih i hemijskih osobina materijala.

- Kod nekih HSP je otkriven efekat električnog prekopčavanja i efekat električnog prekopčavanja sa zapamćivanjem /12, 13/. Radi se o tome da se takvi materijali mogu nalaziti u dva stanja provodnosti: u neprovodnom ili u provodnom, u zavisnosti od jačine električnog polja. Neki materijali mogu ostati praktično beskonačno dugo u provodnom stanju i tu se radi o efektu prekopčavanja sa zapamćivanjem, koji se tumači realizacijom obrnutih strukturnih prelaza tipa staklo - kristal. - Optičke karakteristike nekih HSP se značajno menjaju pod uticajem svetlosti. Radi se o fotoosetljivim HSP /5/ kod kojih dolazi do strukturnih promena i realizacije elektronsko-šupljinskih prelaza između energetskih nivoa pod uticajem svetlosnog zračenja. O njima će biti više reči kasnije.

- HSP poseduju i veliku akustooptičku postojanost i relativno mali koeficijent prigušenja ultrazvučnih oscilacija. Zato se koriste za akustičko moduliranje i skaniranje laserskog zračenja /14/, kao i za izradu talasno-provodnih struktura.

Sve ove osobine su u najvećoj meri određene sastavom stakla, ali i postupkom sintetisanja. Usložnjavanje stakala elementima iz VII grupe periodnog sistema (Cl, Br, J) ili pak bilo kojim drugim elementima omogućava da se kombinacijom komponenata vrši podešavanje izvesnih osobina prema konkretnim potrebama. Najviše su do danas proučena, a i sa praktične strane gledišta, najveći značaj imaju stakla sa osnovom As -B^{VI}, između ostalog zbog ispoljene osobine fotoosetljivosti.

I.2. Formiranje staklastog stanja

Nastanak staklastog stanja - stakljenje - predstavlja postepeno prelaženje podhlađene tečnosti u staklo. Temperaturni interval u kom se ovaj proces dešava naziva se interval stakljenja. Karakteristična tačka koja obeležava ovaj interval je temperatura stakljenja (ili razmekšavanja) T_g i ona se određuje prema položaju naročite tačke na krivoj temperaturne zavisnosti bilo koje fizičke karakteristike supstance. Takođe, ona zavisi od brzine promene temperature, a karakteriše je koeficijent dinamičke viskoznosti od oko 10¹³-10¹⁴P.

Formiranje stakla je u vezi sa prirodom elementarnih komponenti stakla, sa prirodom veza između njih i uređenjem kratkog dometa u rastopljenom stanju. Jedan od kriterijuma obrazovanja stakla se bazira na izgradnji spoljašnjeg elektronskog omotača i ograničava broj elektrona u p-stanju (od 2 do 4) /15/. Najbolja varijanta su 4 p-elektrona. Ovaj kriterijum je odgovoran za gustinu kovalentnih veza i sam po sebi nije dovoljan. Strukturni kriterijum pak predviđa nepromenljivost koordinacionog broja pri prelasku iz tečnog u čvr-

sto stanje i obratno /16/. Takođe je jedan od pokušaja definisanja kriterijuma formiranja stakla pri podhlađivanju rastopa sledeći /17/:

- postojanje u strukturi lokalizovanih veza, nastalih sparivanjem elektrona,

- izgradnja osnovne strukturne mreže od beskonačnih polimernih kompleksa,

- spajanje susednih kompleksa samo putem jedne premošćene, tzv. "zglobne" veze.

Takve strukturne predstave o staklu proizilaze iz postojanja jakih kovalentnih veza između atoma u polimernim lancima koji su međusobno povezani relativno slabim Van der Vaalsovim silama /3/.

Struktura stakla je najčešće preferirana atomima IV ili V grupe periodnog sistema, koji su centralni u strukturnim poliedrima. Dok oni određuju kratkodometnu uređenost, atomi halkogena povezuju poliedre u skeletnu strukturu koja može biti obrazovana od atoma povezanih u lance, kao kod Se, od atoma ujedinjenih u trigonalne strukturne jedinice, kao kod AsSe_{3/2}, ili kombinovanih na neki drugi način /18/. Realna stakla imaju složeniju strukturu određenu sastavom i metodikom sinteze.

Već je ranije rečeno da se amorfni materijali mogu dobiti na dva načina: raspršivanjem na podlogu, u vidu filmova, i hlađenjem rastopa u vidu masivnih uzoraka koji se još nazivaju i staklima. Staklasto stanje nije ravnotežno već metastabilno, sa unutrašnjom energijom većom od iste u kristalnom analogu i zato se zaključuje da jedan isti sastav, dobijen pri različitim uslovima, može imati različite strukture sa različitim stepenom ravnotežnosti. Masivna stakla su stabilnija u odnosu na moguću kristalizaciju, nego tanki filmovi, što je u vezi sa njihovom strukturom.

Treba naglasiti da se višekomponentna stakla ne mogu dobiti sa bilo kakvim odnosom sastavnih komponenti, tj. u oblasti neke zadate grupe elemenata obično je nemoguće dobiti stakla svih sastava. Postoje intervali koncentracija elementarnih supstanci u kojima je moguće varirati sastav smeše, a izvan kojih se dobijaju samo kristalne faze. Međutim, ono što je najinteresantnije i zbog čega su HSP predmet tako intenzivnih istraživanja, je mogućnost i potpuna sloboda narušavanja stehiometrijskih odnosa u formiranju stakla uz proširivanje oblasti obrazovanja stakla određenih sistema. Na slici 1 su prikazane oblasti obrazovanja stakla za neke trokomponentne sisteme /1/. Unutar oblasti obrazovanja stakla uzorci mogu biti dobijeni hlađenjem rastopa. Uzorci sastava izvan te oblasti se eventualno mogu dobiti isparavanjem u vakuumu ili nekom drugom metodom uz specijalne uslove.



Sl. 1. Oblasti obrazovanja stakla nekih trokomponentnih sistema /1/

Stakla sa većom tendencijom ka kristalizaciji, a to su uglavnom stehiometrijski sastavi ili sastavi blizu granice obrazovanja stakla koji postoje i kao kristalni, dobijaju se brzim hlađenjem rastopa. Neka stakla se, opet, mogu dobiti i sporim hlađenjem, što zavisi od sastava i ispunjenosti uslova za stakljenje, odnosno kristalizaciju.

Tanki filmovi debljine reda nekoliko um dobijaju se na razne načine: preko termičkog ili laserskog isparavanja u vakuumu, katodnog raspršivanja, taloženjem preko razlaganja gasa električnim tinjajućim pražnjenjem u atmosferi Si, Ge... i na druge načine. Promenom metodike dobijanja filmova utiče se na fizičke osobine - to se naziva efekt tehnološkog modifikovanja.

I.3. Fotoosetljivost kod HSP

Fotoosetljivost je jedna od najznačajnijih osobina halkogenidnih staklastih poluprovodnika i predstavlja mogućnost promene fizičkih osobina stakala pod uticajem osveljavanja. Drugim rečima, efekt optičkog zapisivanja ili fotoindukovane izmene optičkih konstanti kojeg ispoljavaju neki HSP znači da se pri eksponiranju tankih filmova elektromagnetnim zračenjem zapaža niz promena /19/: pomeranje kraja optičke apsorpcije prema većim talasnim dužinama ("fotozatamnjenje", negativan optički zapis) ili prema manjim talasnim dužinama ("fotoprosvetljavanje", pozitivan optički zapis), koeficijenta apsorpcije «, indeksa prelamanja n, mikrotvrdoće Η, rastvorljivosti, gustine (linijskih razmera), optičke aktivnosti, IC spektara apsorpcije, spektara kvadrupolne rezonancije jezgara, elektrofizičkih i fotoelektričnih osobina i drugih parametara. Isti efekti se ispoljavaju i kod masivnih uzoraka, ali u znatno manjem obimu, pa će ovde biti reči samo o tankim filmovima HSP. Materijali kod kojih su zapažene ove pojave su As, Se, binarni sistemi stakala tipa As-Se, As-S, Ge-Se, kao i tro-, četvoro- i višekomponentna halkogenidna i halkohalogenidna stakla. Prema osetljivosti se dele na stakla sa negativnom ili sa pozitivnom fotoosetljivošću. Velika većina fotoosetljivih materijala ima u svojoj osnovi As-Se i As-S veze, pa ćemo se i mi zadržati na njima.

U procesu naparivanja tankih filmova gasovita faza amorfnog materijala sadrži posebne atome As, Se i dvoatomne komplekse, što utiče na sastav i strukturu sloja koji se kondenzuje na podlogu /20/. Formirani sloj može imati u većoj ili manjoj meri kvazimolekularnu strukturu, čemu doprinose kvantno-mehanička svojstva arsena i selena. Prostorna orijentacija kovalentnih usmerenih veza As i Se omogućava da se formiraju molekuli As₄Se₃, As₄Se₄, As₄Se₅, As₄Se₆ itd., pri čemu postoji potpuna zasićenost svih valenci /21/. Znači, pretpostavlja se da struktura amorfnih slojeva As-Se sadrži kvazimolekularne komplekse As_nSe_m. Tako se može izvesti zaključak da sveže naparivani filmovi na bazi sistema As-Se sadrže dva osnovna vida strukturnih jedinica: kvazimolekularne strukturne jedinice tipa $As_n Se_m$ i jedinice bliže neprekidnoj mreži stakla. Njihov kvantitativni odnos je određen uslovima sinteze, pre svega temperaturom isparavanja T_{isp}. Što je veća vrednost T_{isp}, smanjuje se molekularnost strukture.

Temperatura isparavanja stakla je jedan od najznačajnijih faktora koji utiču na osobine polaznog stakla. Povećanje

njene vrednosti je praćeno smanjenjem temperature početka strukturnih promena T_o. Naime, na toj temperaturi dolazi do strukturnog preuredivanja arseno-selenidnih slojeva iz jedne u drugu modifikaciju, pri čemu se struktura od kvazimolekularne približava strukturi neprekidne staklene rešetke. Istovremeno se, sa povećanjem ^Tisp[,] smanjuje energija aktivacije strukturnih promena, E_o. To se slaže sa pomeranjem kraja optičke apsorpcije stakla prema dugotalasnom delu spektra. Takođe, polazeći od nižih temperatura isparavanja ka višim, dobijamo slojeve prvo sa negativnim fotozapisom, a kasnije sa pozitivnim. To znači sledeće: pri većim T_{isp}energija aktivacije strukturnih promena je manja, pa čak i svetlost većih talasnih dužina, odnosno manje energije, izaziva strukturne promene, a pošto smo imali staklo sa mogućnošću pozitivnog fotozapisa i sa krajem optičke apsorpcije pomerenim u dugotalasni deo spektra, to dolazi do vraćanja kraja apsorpcije u deo spektra manjih talasnih dužina.

Sve u svemu, elementarni sastav stakla i uslovi isparavanja određuju strukturu staloženih slojeva, njihove osobine i smer promena tih svojstava pri odgrevu (zagrevanju materijala do blizu tačke razmekšavanja) ili ozračivanju svetlošću. Takođe se može izvesti zaključak o neposrednoj vezi reverzibilnih promena optičkih konstanti, sa jedne strane, i stepena defektnosti rešetke stakla /23/. Ova veza uslovljava relativno male veličine promena konstanti u masivnim staklima i filmovima stehiometrijskog sastava /24, 25/, a takođe i nemogućnost optičkog zapisa na kristalima sistema As-Se. Ona, isto tako, ističe presudnu ulogu uslova naparivanja na početnu fotoosetljivost filmova.

Na osnovu dosadašnjih istraživanja /22, 26/ se može zaključiti da se svi efekti kod optičkog zapisa na HSP (negativ, pozitiv, brisanje svetlošću i temperaturom) mogu svesti na jedan ciklus promena optičkih parametara fotoosetljivog sloja u režimu "zapis-brisanje" i on je prikazan na slici 2 /22/.

Deo krive 1-2-3-5' pokazuje zavisnost optičke transparencije sveže naparivanog filma dobijenog na $T_{isp} = 880$ K (visoka temperatura isparavanja, što znači da je kraj optičke apsorpcije pomeren ka većim talasnim dužinama i film poseduje sposobnost "fotoprosvetljavanja", pozitivnog optičkog zapisa,



S1. 2. Dijagram promene transparencije pri zapisu na sloju AsSe /22/

koji vraća kraj optičke apsorpcije prema kraćim talasnim dužinama i povećava transparenciju uzorka). Deo krive 11-7-6-5-4 određuje maksimalno dostižni kontrast optičkog zapisa, tj. najveću ili najmanju moguću transparenciju pri pozitivnom, odnosno negativnom optičkom zapisu. Takođe, ovaj deo krive deli sva moguća stanja filma na dva dela. Stanje A, ispod krive 11-7-6-5-4, karak-

teriše "fotoprosvetljavanje" ili povećanje transparencije pri osvetljavanju (2 \rightarrow 6, 8 \rightarrow 6, 3 \rightarrow 5), a stanje B, iznad krive, je svojstveno "fotozacrnjenju" (1→11, 10→7, 9→7), Kriva 11-7--6-5-4 je "karakteristična" kriva fotozapisa za dati sastav i debljinu sloja d. Kriva l'-3' je kriva transparencije sveže pripremljenog sloja na nižim temperaturama isparavanja (T_{isp}≃ ≃600-700 K) i sa njihovim povećanjem se pomera ka delu krive 1-3. U tački njenog preseka sa krivom 11-7-6-5-4 sloj je neosetljiv na zračenje datog intenziteta (temperatura T_D). Ciklus 7-8-6-9-7 i slični njemu pokazuju da je moguća realizacija višestrukih ciklusa "zapis-brisanje svetlošću", pored već ranije utvrđenog procesa "zapis-brisanje odgrevom" (tj. zagrevanjem do blizu tačke razmekšavanja stakla vraća se kraj optičke apsorpcije u prvobitni položaj u spektru koji je imao pre osvetljavanja, odnosno fotozapisa). Na taj način se ekvivalentna stanja realizuju u naizmeničnim ciklusima "zapis-termičko brisanje" ili ciklusima "negativno-pozitivnog zapisa" pri promeni temperature.

I.4. Teorijske pretpostavke o mehanizmu fotostrukturnih promena kod HSP

Osnovni empirijski modeli mogućih mehanizama pri fotoindukovanim izmenama optičkih konstanti se grupišu na sledeći način /19/:

a) Model fotohemijskog razlaganja sa izdvajanjem i klasterizacijom, npr. arsena ili sumpora. b) Model fotostrukturnih promena sa prekidanjem veza i preuređenjem bližeg poretka. Njemu je blizak polimerno-destrukcioni model koji tumači reverzibilne promene HSP.

c) Model, u čijoj su osnovi elektronsko-šupljinski procesi pri foto- i termopobuđivanju stakla, koji utiču na promenu strukturne mreže ili posebnih strukturnih jedinica.

d) Model lokalnog "zagrevanja" i kaljenja oblasti stakla pod dejstvom svetlosti.

Svi oni su u mogućnosti da opišu samo neke delove procesa fotozapisa, no pokušaji kombinovanja i objedinjavanja ovih modela su do sada ostali bez značajnijeg uspeha.

Do danas je ustanovljeno /1, 27/ da je većina fizičkih pojava koje se dešavaju u HSP povezana sa postojanjem stanja, lokalizovanih u "repovima" dozvoljenih i sredini zabranjene

zone. Naime, u zonskoj slici energetskih stanja amorfnih poluprovodnika, prema usavršenom modelu CFO (Koen, Fricše i Ovšinski), kojeg su predložili Devis i Mot /28/ (sl. 3), postoje takozvana "lokalizovana" stanja, skoncentrisana između energija E_c i E_a , E_v i E_b - ona potiču od narušavanja uređenja dugog dometa, dok su stanja oko Fermijevog nivoa, u blizini sredine zabranjene zone širine E_g , posledica defekata u strukturi.

Polazimo od elektronskog mehanizma fotoindukovanih promena



Sl. 3. Zavisnost gustine energetskih stanja od energije u amorfnim poluprovodnicima /28/

/26/ koje su povezane sa delimičnim zahvatom neravnotežnih nosilaca naelektrisanja od strane lokalnih centara. Kada u strukturi stakla postoje atomi sa narušenom koordinacijom (kao što su elementarne komponente u višku, defekti, neuređenost stakla, nestehiometrija sastava...), "lutajuće" veze koje zbog toga nastaju mogu se smatrati takvim lokalnim centrima. Narušene veze atoma As i Se u odnosu na druge, stabilne veze u staklu, mogu biti u pozitivno, neutralno ili negativno naelektrisanom stanju /29/. Prve formiraju donorska lokalizovana stanja u blizini dna provodne zone, druge veze - lokalizovana stanja u sredini zabranjene zone, a treće - akceptorska lokalizovana stanja u blizini vrha valentne zone. Kao rezultat delovanja nepodeljenog

elektronskog para atoma halkogena i "lutajuće" veze, nepodeljeni par trpi transformaciju. Pri obrazovanju treće veze kod atoma halkogena, elektron (sa dovoljnom energijom) odvaja se od njega i biva zahvaćen "lutajućom" vezom na drugom mestu u rešetki stakla. Zato i nastaju lokalizovana stanja C⁺₃ i P⁻₂. Delujući intenzivnim, recimo laserskim zrakom na slojeve stakla, dolazi do generisanja neravnotežnih nosilaca naelektrisanja i pojave elektronsko-šupljinskih prelaza između energetskih zona i tih novih lokalnih centara: elektron valentne zone - provodna zona - C⁺ i šupljina valentne zone - P-. Kao rezultat ovakvog prenaelektrisavanja lokalnih centara (centara zahvatanja) imamo smanjenje gustine stanja, lokalizovanih u "repovima". Kvaziravnotežno metastabilno stanje lokalnih centara koji su obrazovani pri dejstvu svetlosti, stabilno je za datu temperaturu i intenzitet zračenja, i održava se i posle prestanka delovanja svetlosti.

Iz svega toga se može zaključiti da su za zapis odgovorne "lutajuće" veze arsena, kao i primese, defekti, neuredenost strukture, koji utiču na formiranje novih lokalizovanih stanja, između kojih se vrše elektronsko-šupljinski prelazi koji imaju presudnu ulogu pri fotopobuđivanju HSP, a koji su izazvani svetlosnim zrakom, što dovodi do prestruktuiranja stakla (premeštanja atoma sa formiranjem novih metastabilnih kompleksa) i promena brojnih fizičko-hemijskih, naročito optičkih parametara. Procesi su povratni, tako da se termičkim odgrevom ili naizmeničnim ciklusima "zapisbrisanje svetlošću" slojevi mogu više puta koristiti za zapisivanje, očitavanje i brisanje informacija.

Odabiranjem sastava stakla, uslova dobijanja filmova, debljine uzoraka, ekspozicije, moguće je dobiti slojeve sa optimalnim parametrima za date laserske sisteme koji rade u spektralnoj oblasti od 400-800 nm. Fotoosetljivi HSP se zbog svojih osobina veoma raznovrsno primenjuju /19/: za formiranje holografskog pamćenja, za dobijanje elemenata sa arhivskim ili polupostojanim pamćenjem (brisanje svetlošću ili temperaturom), u memorijskim strukturama sa paralelnom ili serijskom organizacijom zapisa, zatim za dobijanje optičkih elemenata (holografske difrakcione rešetke, zamene za sočiva, elementi ulaz-izlaz svetlosti, talasovodi...), za dobijanje ori-

ginala za kopiranje na plastični nosač, za neorganske fotorezistore sa velikom rezolucijom...

II. TENDENCIJA KA KRISTALIZACIJI KOD HALKOGENIDNIH STAKLASTIH POLUPROVODNIKA

II.l. Ponašanje halkogenidnih amorfnih sistema sa temperaturnim promenama

Amorfno stanje je okarakterisano i specifičnim temperaturnim promenama. Pri zagrevanju, stakla (kao vid postojanja amorfnih supstanci) se ne tope, kao kristali, na nekoj odredenoj temperaturi već njihov fazni prelaz čini proces omekšavanja. Pri tome, staklasta tela postepeno prelaze od krtog, preko viskoznog u kapljično-tečno stanje. U ovom procesu se neprekidno menjaju viskoznost, ali i druge termodinamičke osobine I reda (zapremina, entropija...). Masena količina toplote i koeficijent toplotnog širenja, kao termodinamička svojstva II reda, međutim, trpe prekid pri zagrevanju stakla. Ovaj proces topljenja i očvršćavanja je povratan za staklasto stanje i karakteriše ga ceo interval temperatura - interval razmekšavanja (ili stakljenja). Tačka razmekšavanja T_g je temperatura određena kao naročita tačka krivih temperaturnih promena nekih fizičkih veličina.

Stanje staklaste materije je metastabilno, sa unutrašnjom energijom većom nego kod analognog kristalnog sastava. Zato, pri povoljnim spoljašnjim uslovima, može kod stakala doći do pojave samokristalizacije koja je uslovljena sastavom, sposobnošću kristalizacije i spoljašnjim uticajima (pritisak, temperatura, elektromagnetno zračenje...). Kristalizacija stakla je spontan proces na temperaturama ispod krive likvidusa i on se odvija bez ulaganja spoljašnjeg rada.

Stabilnost stakala je povezana sa njihovom strukturom. Stakla jednog te istog sastava, ali dobijena pri različitim uslovima, mogu imati različitu građu i razlikovati se po osobinama u zavisnosti od udaljenosti od ravnotežnog stanja. Tako stakla dobijena hlađenjem rastopa su stabilnija u odnosu na kristalizaciju nego uzorci dobijeni naparivanjem na podlogu /l/. Zahvaljujući tome je moguće da se prelaz iz čvrstog u tečno stanje ostvari bez obeležja faznog prelaza prve vrste. To je karakteristika stakala sa sastavom duboko unutar granice oblasti obrazovanja stakla (sl. l). Kod manje stabilnih stakala, sa sastavom blizu granice obrazovanja stakla, pri sporom zagrevanju može doći do pojave kristalizacije i razdvajanja pojedinih faza. Dalje zagrevanje supstance dovodi do topljenja nastalih faza.

U opštem slučaju, kriva promene entalpije staklastog stanja se može podeliti na tri dela: u oblasti niskih temperatura osobine linearno zavise od temperature; u oblasti visokih temperatura svojstva stakla se takođe skoro linearno menjaju sa temperaturom; oblast srednjih temperatura koja je između prve dve oblasti, okarakterisana je složenijom temperaturnom promenom osobina stakla. Na toj krivoj se mogu izdvojiti dve tačke: tačka T_g je temperatura ispod koje staklo poseduje krtost, sa koeficijentom dinamičke viskoznosti od oko 10^{13} P, dok je tačka T_b temperatura iznad koje staklo poseduje osobine tečnog stanja, sa viskoznošću od oko 10^9 P. Razlika između ove dve temperature zavisi od sastava stakla i iznosi od nekoliko desetina do nekoliko stotina stepeni.

Sve ovo važi za stakla jednostavnijeg sastava (elementarna ili binarna). Složenija stakla, čija je struktura, na bazi binarnih sastava, usložnjena dodavanjem odgovarajućih elementarnih komponenti, pokazuju složeniju zavisnost entalpijskih promena sa temperaturom. To nam govori o postojanju izvesnih procesa strukturnih promena u staklu na temperaturama višim od temperature razmekšavanja T_g. Iz kompletnih derivatografskih ispitivanja složenijih sastava koja obuhvataju, u prvom redu, praćenje promene entalpije, a zatim i mase uzorka, kao i brzine ovih promena sa temperaturom, zključuje se, na osnovu registrovanih egzotermnih i endotermnih procesa, da se na staklenim matricama sa povišenjem temperature izdvajaju faze različitog sastava, kristališu, tope se i razlažu, i na kraju isparavaju sa potpunim ili, što je češći slučaj, delimičnim gubitkom mase.

II.2. Kristalizacija u sistemu Cu-As-Se

Ove temperaturne promene ćemo ukratko prikazati na halkogenidnim sastavima, konkretno na sistemu Cu-As-Se koji je i predmet izučavanja u ovom diplomskom radu. U tom smislu su vršene, kao što je to pokazano u /30, 31, 7/ mikrostrukturne, termičke i rendgenofazne analize potpuno ili delimično kristalisanih sastava koji obrazuju stakla, sa različitim kvantitativnim odnosima selena i bakra $AsSe_{x}Cu_{y}$ (x = 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 4,0; 9,0), i ispitivan uticaj bakra na njihovu termičku stabilnost i kristalizacionu sposobnost. Rezultat toga je podela svih sastava AsSe $_{x}$ Cu $_{y}$ u tri grupe, prema strukturi i svojstvima. Prva grupa su sastavi AsSe_xCu_y za x<2,5; drugu grupu čine jedinjenja sa x≥4, a strukture AsSe_{2,5}Cu_y zauzimaju neko srednje mesto. Jedinjenja I grupe su, u oblasti formiranja stakla, jednovrsna, amorfna, jedino kod sastava na granici obrazovanja stakla moguća je pojava kristalne faze Cu_zAsSe₄. Podaci izučavanja ovih sastava govore o velikom utičaju bakra na strukturno-hemijsku građu kristala. Kristalizaciona sposobnost staklastog stanja se određuje prema postojanju i veličini egzotermnih efekata kristalizacije koji se zapažaju na krivoj diferencijalne termičke analize (DTA), a koji slede neposredno iza endotermnog efekta razmekšavanja stakla. Za sastave AsSe_xCu_y (x≤2,5), znači ne sa suviše velikim sadržajem selena, kristalizacioni afinitet zavisi kako od sadržaja selena tako i od sadržaja bakra. Sa povećanjem udela Se u osnovnoj matrici stakla povećava se kristalizaciona sposobnost. Jedinjenja bez bakra, u vidu masivnih uzoraka, ne ispoljavaju kristalizaciju, nemaju odgovarajuće egzotermne efekte, dok se uvođenjem Cu u sastav počinje javljati, na osnovnoj matrici stakla i na temperaturi svoje kristalizacije -T_{kr}, faza Cu₃AsSe₄. U slučaju izmrvljenih, praškastih uzoraka dolazi do kristalizacije već kod binarnog sistema As-Se, bez dodatka bakra.

Prisustvo bakra u ovim sistemima ima presudni uticaj na kristalizaciju i razliku između temperature razmekšavanja T i temperature kristalizacije T_{kr} . Ova razlika temperatura $\Delta T = T_{kr} - T_{g}$ je jedan od merodavnijih kriterijuma za određivanje kristalizacionog afiniteta stakala. Što je manja razlika △T, to je veća kristalizaciona sposobnost. Ipak, osnovni uticaj na temperaturu T_g, kao i na temperaturni interval, koji odgovara optimalnim uslovima kristalizacije (tab. 1), ima arseno-selenidna osnova stakla. Bakar samo olakšava kristalizaciju.

Nakon prvog egzotermnog efekta koji kod sastava AsSe_xCu_y ($x \leq 2,5$; y > 0), uvek pripada fazi Cu₂AsSe₄ (ona preovladuje u strukturama sa više od 5 at.% Cu), imamo i druge efekte: egzotermne, koji odgovaraju kristalizaciji bilo osnove matrice stakla, bilo, na njenoj bazi, nekih drugih faza

Sastav	Interval temperatura
AsSeCuy	300 - 340 ⁰ C
AsSe1,5 ^{Cu} y	270 – 330 ⁰ 0
AsSe _{2,0} Cuy	220 - 325 ⁰ 0
AsSe ₂ ,5 ^{Cu} y	205 – 290 ⁰ 0

Tab. 1. Optimalni temperaturni intervali kristalizacije /30/

(AsSe, As₂Se₃...), zatim njihovoj dekompoziciji, raspadanju, ali i endotermne koji su posledica topljenja svih tih faza. Što je staklo obogaćenije bakrom ili selenom, to pri zagrevanju pokazuje više strukturnih promena.

Kod stakala II grupe, $AsSe_{4,0}Cu_y$ i $AsSe_{9,0}Cu_y$ pokazano je da ona imaju heterogeni karakter. Već pri malim dodavanjima bakra u As-Se osnovu, dolazi do raslojavanja i u gornjim slojevima imamo osnovnu fazu stakla, a u donjim kristalnu fazu Cu_3AsSe_4 . Zato se na termogramima zapaža, nakon endotermnog efekta razmekšavanja, sasvim mali efekat kristalizacije i znatni efekti topljenja kristalne faze. Pošto su kristalni delići Cu_3AsSe_4 kod ovih stakala blokirani od strane njene matrice $AsSe_x$ ($x \ge 4$), oni ne utiču na fizičke osobine, pa se zaključuje da se ni temperatura razmekšavanja ne menja sa promenom koncentracije bakra (ona zavisi samo od arseno-selenidne strukture stakla).

Sve ovo govori o složenosti mehanizma strukturnih temperaturnih promena kod halkogenidnih stakala, ali omogućuje da se njegovim potpunim poznavanjem bolje prouči kristalizacija stakala i njihovih faza i onemogući njena eventualna pojava pri raznim aspektima upotrebe HSP.

III. METODE ZA KARAKTERIZACIJU KRISTALNE SPOSOBNOSTI KOD SISTEMA Cu-As-Se

Metode koje se najčešće koriste za ispitivanje amorfnih, staklastih poluprovodnika imaju za cilj da prouče njihova fizičko-hemijska svojstva i na osnovu njih da se potpunije iskoriste prednosti koje takvi materijali pružaju. Za nas je bitno ispitivanje strukturnih promena u halkogenidnim staklima sistema Cu-As-Se sa promenom temperature, faznog sastava i, na osnovu toga, izvlačenje zaključaka o procesima kristalizacije i težnji ka njoj za svaki konkretni sastav. Nabrojaćemo četiri metode koje se u tu svrhu koriste.

III.l. Difrakciona analiza na višim temperaturama na polikristalu

Ovom metodom se vrši identifikacija materijala, prisustvo pojedinih faza, njihovo nastajanje, tj. kristalizacija na staklenoj matrici, topljenje ili pak odsustvo, pri čemu se temperatura uzorka može menjati. Merenje se zasniva na difrakciji X-zračenja sa atoma, odnosno molekula supstance koja se ispituje, pomoću uređaja za difrakciju monohromatskog zračenja sa polikristalnog praha - difraktometra. Za neuređene strukture kao što su amorfni, staklasti materijali, neće se dobiti nikakve informacije osim o postojanju neuređenosti, jer uslovi za postojanje difrakcije nisu zadovoljeni. Samo ukoliko postoji uređenje dugog dometa u čvrstim telima, kao kod kristala, javlja se difrakcija X-zraka sa strukturne rešetke. Sama pojava se može objasniti na sledeći način.

Difrakcija rendgenskog zračenja na kristalnoj rešetki se može svesti na refleksiju od familija paralelnih atomskih ravni u kristalu. U difraktometru se snimanje difrakcije vrši na osnovu praćenja intenziteta interferentnog zračenja, reflektovanog od niza familija kristalografskih ravni, u zavisnosti od ugla upadnog zračenja. Naime, prema Bragovom uslovu za selektivnu refleksiju do difrakcije, tj. pojačanja reflektovanih monohromatskih X-zraka od dve susedne paralelne atomske ravni u kristalu (sl. 4) pri određenom upadnom uglu, će doći kada je putna razlika između ta dva reflektovana zraka



Sl. 4. Difrakcija sa niza paralelnih atomskih ravni u kristalu

(koja su u početku bila u fazi) celobrojan umnožak talasnih dužina upotrebljenog zračenja:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = n\lambda$$
$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC} = d \cdot \sin \theta$$
$$2 \cdot d \cdot \sin \theta = n\lambda$$

Znajući vrednosti uglova upadnih zraka i talasnu dužinu rendgenskog zračenja, možemo izračunati međuravanska rastojanja

za familije paralelnih kristalografskih ravni koje su u pogodnom položaju za dobijanje refleksa. Pošto su uzorci u obliku praha, u njima su podjednako, statistički gledano, zastupljena zrnca svih mogućih orijentacija, pa se može smatrati da se u difraktometru samo promenom nagiba preparata u odnosu na upadno X-zračenje mogu dobiti refleksi sa svih mogućih familija paralalnih ravni u kristalu. Poznavajući uglove θ za sve reflekse, računamo sva međuravanska rastojanja za dati uzorak. Međuravanska rastojanja su ključ za identifikaciju materijala, odnosno njegovih faza.

Ono što je važno je da ovaj uređaj ima mogućnost snimanja difrakcije sa promenom temperature uzorka pri čemu se može pratiti nastajanje neke faze, njena kristalizacija, stepen kristaličnosti, topljenje, mogu se određivati temperature dešavanja nekih procesa pa čak i udeo neke faze u uzorku. Za te potrebe se koristi specijalna kamera sa mogućnošću podešavanja temperature i sistem brojač-pisač (povezan sa detektorom difraktovanog X-zračenja) koji na hartiji ispisuje krivu intenziteta difrakcije u funkciji dvostrukog ugla pod kojim zračenje pada na neku od familija kristalnih ravni.

III.2. Diferencijalna termička analiza

Diferencijalna termička analiza (DTA) se obavlja u okviru derivatografskog ispitivanja datog materijala koje predstavlja jedno složeno praćenje temperaturnih promena na datoj supstanci. Suština je u sledećem: određena količina uzorka se po-

stepeno zagreva, u njemu se deševaju promene kao što je kristalizacija, topljenje, dekompozicija sastavnih faza. To je praćeno povećanom apsorpcijom ili oslobađanjem toplote, a ponekad i promenom mase uzorka. Sve ove promene se mogu paralelno beležiti u uređaju koji se naziva derivatograf. Složena termička analiza koju on obavlja sastoji se u praćenju promene težine uzorka (termogravimetrija - TG), u registraciji brzine te promene (diferencijalna termogravimetrija - DTG) i u određivanju brzine entalpijskih promena (diferencijalna termička analiza - DTA). Krive svih ovih promena pri analizi uzorka se automatski beleže zajedno sa promenom temperature na fotoosetljivi papir koji je odgovarajuće kalibrisan. Najviše podataka nam daje DTA kriva, ali se ne može efikasno iskoristiti bez ostalih registrovanih rezultata analize. Tu se u prvom redu misli na položaje pikova DTA krive koji ukazuju na temperature izvesnih procesa, zatim na njihove veličine, što govori o veličini efekta (recimo, stepen kristalizacije...) i na karakter pikova (da li je proces egzotermni ili endotermni).

III.3. Infracrvena (IC) spektroskopija

Metoda IC spektroskopije predstavlja ispitivanje sastava datog materijala na osnovu apsorpcije (ređe refleksije) ovog zračenja /32/. Njome se vrši identifikacija prisutnih jedinjenja, njihova kvantitativna analiza, a daje podatke i o strukturi molekula, njihovom stanju itd. Spektri IC zračenja su, ustvari, vibracioni molekulski spektri. Unutar molekula atomi vrše oscilaciju čije su energije kvantovane veličine. Primanjem energije, tj. apsorpcijom fotona iz, recimo, IC dela spektra, molekul može preći iz osnovnog u neko više (neka je to I pobuđeno) energetsko stanje, a pri vraćanju u osnovni položaj, foton iste energije biva emitovan. Frekvencija emitovanog zračenja je - frekvencija osnovne vibracije. Ako se prelaz ostvaruje između osnovnog i viših energetskih nivoa (ne prvog, najbližeg), frekvencije zračenja koje izostaju u transparentnom spektru nazivaju se - viši harmonici osnovne vibracije. Ako postoji slaganje energetskih nivoa oscilatornog kretanja molekula, onda prelazi sa ili do njih čine - kombinacione trake. I

one i viši harmonici su mnogo manjeg intenziteta od traka osnovnih vibracija koje nastaju apsorpcijom infracrvenog dela spektra elektromagnetnog zračenja.

Uslov za apsorpciju IC zračenja je da oscilacije molekula ne budu potpuno simetrične, jer tada ne proizvode promenu dipolnog momenta. Ako je uslov ispunjen, nastaje apsorpcija zračenja na frekvenciji kojom molekul vibrira i u propuštenom spektru se, u tom delu, javlja apsorpciona traka. Cela oblast IC spektra obuhvata tri dela: bliska IC oblast, $0,78 - 2 \mu m$ (12800 - 5000 cm⁻¹), u njoj je apsorpcija mala, a potiče od viših harmonika i kombinacionih traka; srednja oblast je između $2 \mu m$ i 40 μm (5000 - 250 cm⁻¹) i apsorpcija sadrži intenzivne trake osnovnih vibracija; daleka IC oblast obuhvata talasne dužine preko 40 μm (ispod 250 cm⁻¹) i tu apsorpciju vrše uglavnom samo molekuli sa teškim atomima koji osciluju osnovnim frekvencijama.

Spektrofotometri za infracrvenu spektroskopiju tretiraju uzorak kontinualnim IC spektrom, od 5000 cm⁻¹ pa sve do 400 cm⁻¹ (neki i do 50 cm⁻¹), a propušteno zračenje se preko sistema za detekciju i obradu podataka prenosi na pisač i kao rezultat dobijamo krivu transparencije T (ili apsorbancije $A = \log T_0/T$) u funkciji talasnih brojeva 3, na osnovu koje zaključujemo o sastavu uzorka, o stanju molekula, o koncentraciji, o međumolekulskim interakcijama, o strukturi kristala itd.

III.4. Ramanska spektroskopija

Pri prolasku monohromatskog zračenja, čak i kroz potpuno providne materijale, jedan deo upadnog snopa će se rasejati po celom prostornom uglu usled postojanja mikroskopskih fluktuacija gustine (i indeksa prelamanja), i imaće nepromenjenu talasnu dužinu - to je Rejlijevo rasejanje. Pored ovog efekta, u spektru rasejanog zračenja se zapažaju i diskretne linije većih i manjih talasnih dužina - to je Ramanov efekt ili kombinaciono rasejanje /32/. Suština procesa je sledeća: foton, određene talasne dužine, interaguje sa molekulom određene oscilatorne energije. U jednom slučaju on predaje onaj deo svoje energije molekulu u osnovnom stanju koji prebaci mo-

lekul na neki viši vibracioni nivo od I pobuđenog, i pri povratku na niži, ali ne osnovni, emituje se foton rasejanog zračenja manje energije, tj. veće talasne dužine (Stoksovske linije). U drugom, manje verovatnom slučaju, foton interaguje sa molekulom na nekom od viših nivoa oscilatorne energije i rezultat povratka molekula u osnovno stanje je emisija fotona veće energije i manje talasne dužine (antistoksovske li-

nije). Stoksovske linije su znatno intenzivnije od antistoksovskih i ono što je interesantno, i jedne i druge za isti iznos energije (ili talasnog broja) odstupaju od centralne linije koja odgovara upadnom zračenju (sl. 5).

Uslov za nastanak Ramanovog efekta je da dato oscilovanje molekula proizvodi promenu nje-



Sl. 5. Ramanski spektar tečnog CS₂ /32/

gove polarizibilnosti, a to se odnosi i na potpuno simetrične vibracije koje su pak u IC spektroskopiji neaktivne. Takođe, kod složenijih i nesimetričnih molekula položaji traka se u Ramanovom i u IC spektru poklapaju, ali zbog manjeg intenziteta viših harmonika i kombinacionih traka Ramanovi spektri više ističu osnovne vibracije. Iz toga se zaključuje da se ove dve metode, snimanja Ramanovih i IC spektara, nadopunjuju. Treba istaći da je detekcija u dalekoj IC oblasti povezana sa veoma mnogo eksperimentalnih teškoća, a da Ramanov efekat prebacuje isti problem u vidljivo područje, što je velika prednost u odnosu na neke aspekte praktičnih rešenja.

Uređaji za snimanje Ramanovih spektara koriste ili živin luk ili zračenje lasera za pobuđivanje oscilatorne energije molekula, dok su detektori na bazi fotografske ili fotoelektrične registracije i daju podatke kao i IC apsorpcioni spektri - o vibracijama molekula, a na osnovu toga o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu, stanju supstance i strukturi kristalne materije.

EKSPERIMENTALNI DEO

•

i

Eksperimentalni deo diplomskog rada se u osnovi sastoji iz dva dela. U prvom delu smo vršili sintezu datog jedinjenja, a u drugom delu njihova rendgenska ispitivanja do temperatura od 500°C i termička ispitivanja, tj. snimane su krive DTA (promene entalpije procesa), TG (promene mase uzorka), DTG (brzine promena masa uzoraka) i temperaturne krive T.

SINTEZA

Sintezu smo vršili sa stehiometrijskim odnosom elementarnih supstanci u polaznoj smeši i to kristalnih uzoraka CuAsSe₂, Cu₃AsSe₄, Cu₂Se i amorfnih Cu₂₅(As₂Se₃)₇₅ i Cu₃AsSe₄. Masa svakog uzorka je trebala biti 5 g i zato smo vršili proračun masa polaznih supstanci za svako jedinjenje posebno. Kao primer, navodimo proračun za jedinjenje CuAsSe₂.

Potrebno je prvo odrediti molarnu masu ovog sastava. Uzimajući tablične vrednosti za Cu, As i Se, dobijamo sledeće:

$$M_{Cu} = 63,546 \text{ g/mol}$$

 $M_{As} = 74,9216 \text{ g/mol}$
 $M_{Se} = 78,96 \text{ g/mol}$
 $M_{CuAsSe_2} = 296,3876 \text{ g/mol}$

Ukupna masa bakra u jednom molu ovog jedinjenja je 63,546 g, a to iznosi 21,44 mas. %. Analogno se nalazi procentualno maseno učešće arsena - 25,28 mas. % i selena -53,28 mas. %. Na osnovu toga se preračunava masa elementarnih supstanci za uzorak od 5 g:

 $m_{Cu} = 1,07200 \text{ g}$ $m_{As} = 1,26390 \text{ g}$ $m_{Se} = 2,66410 \text{ g}$

Isti postupak smo ponovili za sve sastave predviđene za sintezu. U tabeli 2 su date mase svih komponenti za sve uzorke. Odmeravanje ovih masa polaznih supstanci smo vršili na analitičkoj vagi marke "mettler" B-6, sve sa tačnošću $\pm 5 \cdot 10^{-5}$ g. Čistoća arsena i selena je bila vrlo visoka (99,99 %), dok je čistoća bakra - 99,8 %. Arsen je bio u obliku komadića raznih veličina, selen u obliku granula, a bakar u obliku praha.

Sastav	mas. %		m [g]			
	Cu	As	Se	Cu	As	Se
CuAsSe2	21,44	25,28	53,28	1,07200	1,26390	2,66410
Cu ₃ AsSe ₄	32,79	12,89	54,32	1,63950	0,64430	2,71620
Cu ₂ Se	61,68	-	38,32	3,08400	-	1,91600
^{Cu} 25 ^{(As} 2 ^{Se} 3)75	21,50	30,42	48,08	1,07494	1,52084	2,40422

Tab. 2. Mase sastavnih komponenti

Ampule koje smo koristili u sintezi bile su od kvarcnog stakla zbog potrebe izdržavanja visokih temperatura (i malog koeficijenta toplotnog širenja), prečnika do 15 mm, debljine zidova 2-3 mm i dužine oko 20 cm. Pre unošenja supstanci ampule se drže u hrom-sumpornoj kiselini oko 1 dan zbog očišćavanja, zatim se peru destilovanom vodom, alkoholom i suše izvesno vreme. Nakon tog postupka, u njih se ubacuju odmerene supstance, jedna po jedna, uz stalno proveravanje mase ubačenih komponenti. Pripremljene ampule se vakuumiraju pomoću vakuum-pumpe oko 10 minuta, do pritiska reda 10² Pa i zatapaju pomoću kiseonično-acetilenskog plamena.

Peći za sintezu uzoraka su sa manuelnim podešavanjem i automatskim održavanjem temperature. U komoru peći se postavlja jedan šuplji cilindar, sa jedne strane zatvoren, pod malim nagibom, na dva nosača različite visine i u njega se polaže ampula sa smešom supstanci datog sastava. Nakon toga se može otpočeti sa sintezom. Pošto su temperature topljenja pojedinih elemenata, kao i njihovih međusobnih spojeva, različite, to se sinteza vrši prema sledećem režimu /33, 34, 35/: ampula se u početku, od sobne temperature - oko 293 K (20°C), zagreva brzinom (2,5 - 3,0)·10⁻² Ks⁻¹, odnosno (90 - 108)^oCh⁻¹ do 620-630 K (347 - 357⁰C) i na toj temperaturi drži najmanje (1,2 - 1,5)·10⁴s, tj. 3 - 4 sata. Zatim se brzinom (3,5-4,0)· ·10² Ks⁻¹ ili (126 - 144)[°]Ch⁻¹ zagreva ampula do 900 - 920 K, tj. 627 - 647°C i na toj temperaturi održava (1,5 - 1,8) $\cdot 10^4$ s, odnosno 4 - 5 sati. Posle toga se temperatura podiže brzinom $(2,5 - 3,0) \cdot 10^{-2} \text{ Ks}^{-1}$, $(90 - 108)^{\circ} \text{Ch}^{-1}$ do 1120 - 1170 K, odnosno do 847 - 897° C i održava u toku $(4 - 6) \cdot 10^{4}$ s, tj. 11 - 17 sati. Ovakvo stepenasto dizanje temperature omogućava smanjivanje pritiska para arsena koje stupaju u reakciju sa selenom i bakrom, i sprečava razaranje ampule u toku sinteze. U cilju halogenizacije i homogenizacije uzorka, rastop se održava pri maksimalnoj temperaturi što je moguće duže vreme.

Svi uzorci su dobijeni primenom, u osnovi, iste metodike. Razlika je bila u trajanju održavanja ampula na pojedinim temperaturnim platoima i u načinu hlađenja. Naime, jedinjenja koja su trebala da kristališu trebalo je što je moguće sporije hladiti radi formiranja kristalne rešetke. Na osnovu procene je zaključeno da je za kristalisanje spojeva dovoljno sporo spontano hlađenje u peći. Eksperimentalna karakteristika takvog hlađenja je data na slici 6. Temperatura opada po, približno, eksponencijalnoj zavisnosti, prema Njutnovom zakonu hlađenja:



$$t = t_s + (t_o - t_s) \cdot e^{-kb}$$

Sl. 6. Eksperimentalna karakteristika spontanog hlađenja peći

(t_s - sobna temperatura, t_o - maksimalna temperatura na kojoj započinje proces hlađenja, \mathcal{C} - vreme, k - koeficijent koji zavisi od karakteristika peći, $\begin{bmatrix} s^{-1} \end{bmatrix}$).

Za dobijanje amorfnog sastava, za razliku od prethodnog slučaja, hlađenje treba da je što brže, naročito u intervalu temperatura gde takvo jedinjenje (ili neka od njegovih faza) kristališe. U tom smislu se ampula vadi iz peći pri maksimalnoj temperaturi sinteze i odmah stavlja u beli prah, glinicu, koja omogućava brzo hlađenje rastopa. U njoj se ampula još ostavi izvesno vreme (24 h) i nakon toga je uzorak spreman za obradu i merenje.

Eksperimentalne vrednosti temperatura i vremena, odnosno postupci sinteze za kristalne sastave i amorfni Cu_3AsSe_4 su prikazani na slikama 7, 8, 9 i 10. Sastav Cu_3AsSe_4 smo, osim u kristalnom, pokušali da dobijemo i u amorfnom stanju. Međutim, i pored brzog hlađenja dolazi do njegove kristalizacije, što je kasnije pokazano difraktometrijskim snimanjem njegovog praha. Jedinjenje $Cu_{25}(As_2Se_3)_{75}$ je sintetisano po







postupku kao i za amorfni Cu_3AsSe_4 . Ohlađene ampule se otvaraju sečenjem u njihovom gornjem, zatopljenom delu. Uzorci su bili sivi, metalnog sjaja, veličine reda $0,2 \times 1 \times 4$ cm, osim Cu_2Se koji je ispunio celu zapreminu donjeg dela ampule do visine od oko 2 cm.

TERMIČKA ANALIZA

Termička analiza sintetisanih uzoraka se svodi na derivatografsko ispitivanje promena na jedinjenjima pri njihovom postepenom zagrevanju. To podrazumeva praćenje entalpijskih procesa i promena u masi datih sastava.

Uzorak određene mase (100 mg) se stavlja u derivatograf, uređaj koji simultano prati promene temperature, apsorpciju ili oslobađanje toplote od strane uzorka, promenu i brzinu gubljenja njegove mase. Aparat firme "MOM" (Budapest) istovremeno beleži nabrojane efekte na fotoosetljivom papiru, postav-

ljenom u cilindričnu kasetu preko svetlosnih snopova galvanometara koji reaguju na svaki proces termičke strukturne promene. Snimanje svakog uzorka je trajalo 100 min. (u atmosferi vazduha) i za to vreme se njegova temperatura menjala od sobne pa sve do 1000° C. Kao standard je korišćen $\ll - Al_2 O_3$. Po isteku snimanja se fotopapir razvija i dobija integralna derivatografska slika. Termičkoj analizi su bili podvrgnuti kristalni sastavi CuAsSe₂, Cu₃AsSe₄, Cu₂Se, i amorfni Cu₂₅(As₂Se₃)₇.



S1. 11. Derivatogram kristalnog CuAsSe2









i As₂Se₃. Derivatografski snimci ovih analiza su prikazani na slikama 11, 12, 13, 14 i 15. Oni ukazuju na pojavu endotermnih procesa razmekšavanja i topljenja ili egzotermnih procesa kristalizacije i dekompozicije, kao i na njihov kvantitativni karakter (DTA). Takođe se sa takvih snimaka očitava i gubitak mase pri isparavanju supstance (TG kriva) i brzina takve promene (DTG). Na taj način se može analizirati nastajanje pojedinih faza u datom sastavu i pratiti promene na njima sve do njihove dekompozicije.

RENDGENSKA ANALIZA DO 500°C

Rendgenska ispitivanja smo vršili u dve faze. Jedna je snimanje difrakcije monohromatskog X-zračenja na datim uzorcima na sobnoj temperaturi, a druga je snimanje difrakcije uz promenu temperature uzoraka, najviše do 500°C. U radu smo koristili difraktometar "PW 1965 (Philips)" sa visokotemperaturnim adapterom. Sistem je snabdeven brojačem i pisačem tako da automatski, u toku rada instrumenta, dobijamo na hartiji iscrtanu zavisnost intenziteta difraktovanog zračenja od uglova upadnog zračenja na uzorak. Rendgensko zračenje koje se koristi pri snimanju je monohromatski paralelan snop talasne dužine λ = 1,54178 Å, koji se dobija u rendgenskoj cevi sa bakarnom antikatodom kada se iz njenog karakterističnog spektra izdvoji, pogodnim izborom filtra, K. linija. Na difraktometar se mogu postavljati dve vrste kamera. Jednu koristimo u prvom delu ispitivanja i služi za snimanje difrakcije na sobnoj temperaturi. U nju se postavlja uzorak nanešen na staklo. Druga vrsta kamera služi za temperaturna snimanja i u njoj je uzorak postavljen na platinski nosač koji se može zagrevati. Za ovu kameru se može programirati brzina i smer promene temperature, tj. da li će rasti ili opadati. Za hlađenje sistema se koristi protočna voda.

Za obe vrste snimanja upotrebljeni su uzorci u obliku praha. Za difrakciju na sobnim temperaturama se takav prah nanosi pomoću vakuum masti na stakleni (amorfni) nosač i površina mu se izravnava. Za drugu kameru se praškasti uzorak nanosi na šinu od platine pomoću specijalnog lepka. Kameru se hermetički zatvara zbog eventualne potrebe da se snimanje vr-





S1. 18. Difraktogram Cu₂Se na sobnoj temperaturi

ši u vakuumu. Rezultati snimanja rendgenograma na sobnoj temperaturi praškastih kristalnih uzoraka $CuAsSe_2$, Cu_3AsSe_4 i Cu_2Se su prikazani na slikama 16, 17 i 18, a odgovarajuća meduravanska rastojanja d, karakteristična za pojedine sastave i određena sa dobijenih difraktograma, su prikazana u tabelama 3, 4 i 5.

R. br.	a [Å]	I/I ₀ [%]
1	3,17	61
2	1,95	100
3	1,66	23
4	1,38	6
5	1,26	23
6	1,12	24
7	1,06	8

R. br.	d [Å]	I/I ₀ [%]
1	3,17	100
2	1,95	83
3	1,66	52
4	1,38	16
5	1,27	17
6	1,13	25

Tab. 3. Međuravanska rastojanja za CuAsSe₂ na sobnoj temperaturi

Tab. 4. Međuravanska rastojanja za Cu₃AsSe₄ na sobnoj temperaturi

Takođe se, na osnovu rendgenskih snimaka, može odrediti i stepen kristaličnosti pojedinih jedinjenja. Konkretno, pokušana je sinteza amorfnog Cu₃AsSe₄ koja, i pored brzog hlađe-

R. br.	d [Å]	I/I ₀ [%]
1	6,73	26
2	3,50	8
3	3,37	86
4	2,32	10
5	2,26	49
6	2,06	100
7	1,76	53
8	1,52	6
9	1,34	7
10	1,13	12

Tab. 5. Međuravanska rastojanja za Cu₂Se na sobnoj temperaturi

nja, nije uspela, što se vidi upravo iz difraktograma takvog sastava. Jedna od metoda određivanja stepena kristaličnosti je da se izmeri površina karakterističnog pika za datu supstancu na sobnoj i na temperaturi na kojoj taj pik ima najveći intenzitet i uporede dobijene veličine. Tako je dobijeno da je "amorfni" CuzAsSe₄ ustvari kristalisao do stepena od oko 75%. Praćenje stepena kristaličnosti tog uzorka je prikazano na slici 19 (praćenje pika 2.0 = = 28,15⁰). Pored ovog, i kristalni CuAsSe, je analiziran. Kod njega

je praćen stepen kristaličnosti za njegovu sastavnu fazu Cu₃AsSe₄ Rezultat je - 54%. Daljim zagrevanjem maksimalno kristalizovanih uzoraka dolazi do topljenja analiziranih faza ili prekristalizacije, što se registruje snimanjem difrakcije na višim temperaturama. Tako naizmenična snimanja i praćenja kristalizacije i topljenja sastavnih, tj. novonastalih faza, obavili smo kod kristalnih CuAsSe₂ i Cu₃AsSe₄ koji se ujedno javlja i kao jedna od faza u prvom jedinjenju.

Uzorak CuAsSe₂ je zagrevan do temperature od 370°C (praćeno je topljenje faze Cu₃AsSe₄ preko difrakcionog maksimuma na $2 \cdot \theta = 28,15^{\circ}$) i nakon toga ohlađen i snimljen (sl. 20). Uzorak kristalnog Cu₃AsSe₄ je tretiran do 365°C (praćeno je takođe topljenje osnovne faze) a zatim i do 440°C (praćeno je topljenje prethodno formiranog Cu_{2-x}Se preko promene intenziteta difrakcionog maksimuma na $2 \cdot \theta = 26,7^{\circ}$), posle čega je uzorak kompletno snimljen (sl. 21).



41

-



DISKUSIJA REZULTATA

Rezultati termičkih i rendgenskih analiza ukazuju na izvesnu složenost strukturnih promena izazvanih zagrevanjem datih uzoraka. To je i jedan od glavnih razloga zbog čega smo ispitivali i dvokomponentne sisteme Cu₂Se i As₂Se₃. Naime, ove strukturne jedinice su redovno sastavne faze halkogenidnih stakala iz sistema Cu-As-Se koje se ispoljavaju pri zagrevanju datih uzoraka.

Rendgenogram bakar-selenida, Cu_2Se (slika 18) govori da smo u sintezi dobili sastav visokog stepena kristaličnosti i očekivanih vrednosti međuravanskih rastojanja (tabela 5). Derivatografski snimak kristalnog Cu_2Se (slika 13) pokazuje da se na 625°C odvija termička dekompozicija delimično oksidisanog uzorka. Oslobađa se selen, a ostaje bakar-oksid, Cu_2O .

Na slici 15 je termička analiza amorfnog arsen-triselenida, As₂Se₃. Na temperaturi od 380°C dolazi do delimične kristalizacije, da bi na oko 580°C počela termička dekompozicija.

Rendgenogrami (slike 16 i 17) trokomponentnih sastava CuAsSe₂ i Cu₃AsSe₄ na sobnoj temperaturi (i staklenoj podlozi) pokazuju relativno visoki stepen kristaličnosti, što je i razumljivo s obzirom na stehiometrijski odnos elementarnih komponenti u njima. Upoređujući tabele 3 i 4 zapaža se velika podudarnost u strukturi, što se slaže sa podacima u literaturi /30, 31, 36/. Objašnjenje može biti dvojako. U /36/ se ističe da CuAsSe₂ i Cu₃AsSe₄ imaju identične sfaleritne strukture koje se razlikuju samo u stepenu distorzije elementarne ćelije, zbog čega i dolazi do izražaja, recimo, dubletni karakter više kod Cu₃AsSe4 nego kod CuAsSe2. Drugo tumačenje /30, 31/ tvrdi da jedinjenje CuAsSe₂ kao takvo ne postoji, već se pri pokušaju da se dobije kao kristalno najverovatnije obrazuju Cu₃AsSe₄ i AsSe: 3CuAsSe₂→Cu₃AsSe₄ + 2AsSe, pri čemu je istovremeno moguća i reakcija prelaska monoselenida u triselenid arsena: $3AsSe \rightarrow As_2Se_3 + As_4$

Jedinjenje arsen-monoselenid vrlo teško kristališe, pa dominiraju u rendgenogramu od CuAsSe₂ samo linije koje karakterišu Cu₃AsSe₄. Moguće je opet da se radi o kombinaciji ova dva stava. Drugim rečima, osnovna i distorgovana sfaleritna struktura $CuAsSe_2$ nemaju jednaki energetski minimum, što uslovljava, u zavisnosti od spoljašnjih uslova, da manje stabilni oblik u stehiometrijskom sastavu $CuAsSe_2$ delimično prelazi u AsSe. Zbog toga se u oba slučaja (slika 16 i 17) zapaža samo Cu_zAsSe_u .

Kao što je već rečeno, amorfni Cu_3AsSe_4 , i pored brzog hlađenja u postupku sinteze (slika 10), nismo uspeli dobiti. To se vidi sa snimka intenziteta difrakcije X-zračenja, odnosno praćenja stepena kristaličnosti pri porastu temperature uzorka (slika 19). Posmatra se difrakcioni maksimum na $2 \cdot \theta = 28,15^{\circ}$ koji se na temperaturama kristalizacije povečava karakterišući najveći stepen kristalizacije. Ako ga uporedimo sa njegovom veličinom na sobnoj temperaturi, dolazimo do zaključka da je naš sastav u visokoj meri (75%) kristaličan.



S1. 22. Fazni dijagram za sistem Cu-As-Se /37/, 1 - Cu₂Se, 2 - Cu₃AsSe₄, 3 - Cu₂₅(As₂Se₃)₇₅, 4 - CuAsSe₂, 5 - As₂Se₃

Nemogućnosti dobijanja amorfnog Cu₃AsSe₄ doprinosi stahiometrija sastava, što se potkrepljuje i podacima iz faznog dijagrama (dijagrama obrazovanja stakla) nekih autora /37/ - slika 22. Na dijagram smo uneli sve sastave koje smo sintetisali i sa kojima smo radili.

Derivatografski snimak Cu_3AsSe_4 (slika 12) pokazuje sledeće: na temperaturi od 395°C (pik 1) se oslobađa Se_2 termičkom dekompozicijom; na temperaturi 435°C (pik 2) formiraju se kristalne faze Cu_2Se i As_2Se_3 , što je registrovano i na difrakcionom snimku (slika 21) na temperaturi od 440°C; nakon toga se na temperaturi od 475°C (pik 3) odvija proces dekompozicije arsen-triselenida, As_2Se_3 , a na 525°C (pik 4), zahvatajući kiseonik iz atmosfere, bakar se oksidiše. Dekompozicija delimično oksidisanog bakro-selenida je na oko 600°C (pik 5). Na kraju se selen ponovo oslobađa na 650°C (pik 6), što odgovara procesu koji se odvija u čistom Cu_2Se (slika 13).

Derivatografski snimak $CuAsSe_2$ (slika 11) se malo razlikuje od snimka Cu_3AsSe_4 , što ukazuje na njegovu složenost sastava. Ovde takođe imamo egzotermne pikove, verovatno dekompozicije selena na 420°C, zatim odlaska As_2Se_3 na 495°C, kao i Cu_2Se na 590°C (zapaža se razlika u temperaturama ovih procesa u odnosu na sastav Cu_3AsSe_4).

Snimak difrakcije kristalnog CuAsSe₂ nakon zagrevanja do 370° C i hlađenja (slika 20), a takođe i snimak Cu₃AsSe₄ na temperaturi od 440°C (slika 21) nam dozvoljavaju da zaključimo sledeće: osnovna, sfaleritna strukturna jedinica se topi nakon 330° C pri čemu dolazi do formiranja faze Cu_{2-x}Se, koja se topi nakon zagrevanja uzorka do preko 400°C, prelazi u «Cu₂Se, pri čemu nastaju oksidi bakra (CuO i Cu₂O), dok se u veoma maloj meri, u vidu ostataka, pojavljuju Cu₃AsSe₄ i As₂Se₃.

Na kraju još analizirajmo derivatografski snimak amorfnog $Cu_{25}(As_2Se_3)_{75}$, slika 14, i snimak praćenja stepena kristaličnosti sa temperaturom preko referentnog difrakcionog maksimuma $(2 \cdot \theta = 28, 15^{\circ}, karakteriše prisustvo Cu_3AsSe_4)$, slika 23. Zapaža se kristalizacija faze Cu_3AsSe_4 na temperaturi od oko 255°C na difraktogramu, dok se na derivatogramu može izdvojiti temperatura razmekšavanja amorfne faze (160°C) i temperatura kristalizacije (oko 300°C). Zaključuje se da se elementarne jedinice u amorfnom sistemu formiraju na bazi sfaleritne koordinacije Cu_3AsSe_4 .



ZAKLJUČAK

U ovom radu su eksperimentalno razmatrani dvo- i trokomponentni sastavi iz sistema Cu-As-Se zbog povoljnih karakteristika koje poseduju u smislu fotoosetljivosti, a sa ciljem da se, objedinjavanjem saznanja o njihovom ponašanju, sa porastom temperature, oni što bolje upoznaju i time pruži mogućnost njihovom što boljem iskorišćenju.

Na osnovu termičkih i rendgenskih analiza do 500° C stehiometrijskih sastava CuAsSe₂ i Cu₃AsSe₄ se može zaključiti da u halkogenidnom sistemu Cu-As-Se postoji izrazita tendencija ka kristalizaciji u okolinama tačaka faznog dijagrama koje odgovaraju stehiometrijskom odnosu. Osnovne strukturne jedinice u svim arseno-selenidnim sastavima sa bakrom su sfaleritnog tipa - Cu₃AsSe₄. One se najverovatnije odražavaju, kao karakteristika prve koordinacije, i u amorfnim sistemima ovoga tipa. Prilikom termičkog tretmana se formiraju kristalne faze Cu₂Se i As₂Se₃, što ukazuje na složenost termičkih procesa u amorfnim sastavima sistema Cu-As-Se.

LITERATURA

- 1. Мотт Н., Дэвис Э., Электронные процессы в некристаллических веществах, Москва, "Мир", 1974, с. 198-207.
- 2. Фельц, Аморфные и стеклообразные неорганические твердые тела, Изд. "Мир", 1986.
- Костылев С. А., Шкут В. А., Электронное переключение в аморфных полупроводников, Киев, "Науковая думка", 1978, с. 5-25.
- 4. Скрышевски А. Ф., Структурный анализ жидкостей и аморфных тел, Москва, "Высшая школа", 1980, с. 302.
- 5. Brandes R. G., Laming F. P., Pearson A. P., Gllass Appl. Opt., 1970, 9, No 7, pp 1712-1714.
- Turyanitsa I. I., Khiminets O. V., Lukić S. R., Petrović D. M., Characteristics of optical recording on thin films of quaternary glasses Cu-As-Se-J, J. Mat. Sci. (u štampi).
- 7. Lukić S. R., Petrović A. F., Petrović D. M., Thermal Stability and photorecording in amorphous Cu_x(As₂Se₃)_{1-x} system, Fizika, vol. 21, 1989, s. 211-215.
- 8. Губанов А. И., Квантовс-электронная теория аморфных полупроводников, М-Л, Изд. АН СССР, 1963, с. 250.
- 9. Petrović D. M., Himinec V., Poluprovodnička stakla halkogenida arsena (u štampi).
- 10. Коломиец Б. Т., Стеклообразные полупроводники, Изд. "Знание", 1969.
- 11. Минаев В. С., Стеклообразные полупроводниковые материалы, синтез, свойства, применение, Изд. ЦНИИ Электроника, 1974.
- 12. Костылев С. А., Шкут В. А., Электронное переключение в аморфных полупроводниках, Изд. "Науковая думка", 1978.
- 13. Коломиец Б. Т., Лебедев А. А., Таксами И. А., ФТП, 1969, т. 3, в. 5, 731-735.
- 14. Баладис Ю. Н., Акустооптическое сканирование лязерного излучения, Изд. ЦНИИ Электроника, 1972.
- Винтер-Клайн А., Структура и физические свойства стекла,
 в. кн. Стеклообразное состояние, Тр. 4 Всесоюз. совещ.
 М.-Л. 1965, с. 45-48.

- 16. Дембровский С. А., Сопоставление физическо-химических свойств халькогенов и основных халькогенидных соединений (стеклообразователей), Изд. АН СССР, Неорганические материалы, 1969, Но. 3, с. 463-471.
- 17. Кокорина В. Ф., Влияние химической связы на стеклообразование и свойства стекол, в кн. Стеклообразное состояние, Тр. 5 Всесоюз. совещ. М.-Л. 1969, 1971, с. 87-91.
- 18. Немилов С. В., Исследование структуры полупроводниковых стекол систем Se-As и Se-Ge, Изд. АН СССР, Физика, 1964, 28, Но. 8, с. 1283-1284.
- 19. Борец А. Н., Химинец В. В., Туряница И. Д., Кикинеши А. А., Семак Д. Г., Сложные стеклообразные халькогалогениды, Львов, Вища школа, 1987, с. 104-126.

Stod

- 20. Горбов С. Н., Крестников А. Н., Давление пара селенида мышяка, Журнал неорг. химии, т. 13, Но. 6, с. 1482-1487.
 - 21. Daniel M. F., Leadbetter A. I., Wight A. C., et all., The structure of vapour-deposited arsenic-sulphides, J. Non. Cryst. Sol., 1979, Vol. 32, N 1-3, p. 281-293.
 - 22. Туряница И. И., Кикинеши А. А., Семак Д. Г., Эффект позитивной фотозаписи на слоях халькогенидных стеклообразных полупроводников, Укр. физ. журн., 1979, т. 24. Но. 4, с. 534-537.
 - Микла В. И., Семак Д. Г., Кикинеши А. А., Дрейфовая подвижность и фотоиндуцированные изменения в халькогенидных стеклообразных полупроводниках, Укр. физ. журн., 1980, т. 25, Но. 12, с. 2021-2026.
 - 24. Кикинеши А. А., Семак Д. Г., О реверсивности фотозаписи на стеклах из систем As-Se, Журн. науч. и прикл. фотографии и кинематографии, 1975, т. 20, Но. 4, с. 299-302.
 - 25. Семак Д. Г., Кикинеши А. А., Михалько И. П., Электронный механизм сотоиндуцированных изменений в халькогенидных стеклах, Физика и химия стекла, 1976, т. 2, Но. 5. с. 457-460.
 - 26. Власов В. И., Семак Д. Г., Чепур Д. В., О механизме фотоиндуцированных изменений оптических констант в халькогенидных стеклах на основе As-Se, Физика, 1978, т. 12, В п. I, с. 48-52.
 - 27. Mott N. F., Electrons in glass, Revue de physique applique, 1977, 12, No 5, 513-630.

48

- 28. Davis E. A., Mott N. F., Conduction in non-crystalline systems V. Conductivity, Optical absorbtion and photoconductivity in amorphous semiconductors, Phill. Mag., 1970, 22, No 179, p. 903-922.
- 29. Kastner M., Defects in lone-pair semiconductors: the valence-alternation model and new directions, J. of Non--Cryst. Sol., 1980, p. 35-36, No 2, p. 807-817.
- 30. Орлова Г. М., Адимбарашвили Н. А., Кожина И. И., Дорогокупцева А. П., О характере структурно-химического взаимодействия компонентов в стеклообразной системе As-Se-Cu, Журнал прикладной химии, Ленинград, 1972, т. 45, в п. 11, Но. 11, с. 2385-2389.
- 31. Саван Я., Кожина И. И., Орлова Г. М., Биндер Х., Исследование кристализации стекол в системе Си-Ав-Se, Изд. АН СССР, Неорганические материалы, 1969, т. 5, Но. 3. с. 492-497.
- 32. Dorđević S., Doroslovački I... Hemijsko-tehnološki priručnik, knj. 3, Fizičko-hemijske metode, "Rad", Beograd, 1985, s. 211, 251-266, 341-342.
- 33. Туряница И. Д., Семак Д. Г., Кикинеши А. А., Химинец В. В., Туряница И. И., Светочувствительные материалы в системе Cu-As-Se-J, Ж. всес. хим. об-во им. Д. М. Менделеева, 1975, т. 20, Но. 5, с. 592-593.
- 34. Химинец В. В., Туряница И. Д., Чепур Д. В., Термографические исследования халькогенидных стекол сложного состава, Сб.: Вопросы физики полупроводников, Калининград, 1975, с. 93-96.
- 35. Химинец В. В., Особенности стеклообразования и свойства стекол в четверных халькогалогенидных системах M^{I} -As- B^{VI} -J, Сб.: Сложные полупроводники, Ужгород, 1981, с. 107-120.
- 36. Liang K. S., Bienenstock A., Bates C. W., Structural studies of glassy CuAsSe₂ and Cu-As₂Se₃ alloys, Phys. Rev. B., vol. 10, No 4, 1974, p. 1528-1538.
- 37. Саван Я., Кожина И. И., Борисова З. У., Вестник ЛГУ, Физика и химия, 1967, Но. 10, в п. 2, с. 141-144.